【 支援装置料金表＜データ提供**あり**＞ 】2024年4月1日 改定

北海道大学 ナノテクノロジー連携研究推進室

設備番号	装置名	メーカー	型式	初回講習料	利用料(円/1h)		技術補助料(円/1h)		技術代行料(円/1h)	
					学外者(大学・公的機関)	学外者(一般)	学外者(大学・公的機関)	学外者(一般)	学外者(大学・公的機関)	学外者(一般)
AP-200001	超高精度電子ビーム描画装置 125kV	エリオニクス	ELS-F125-U	35,200	3,700	8,300	8,100	12,700	12,500	17,100
AP-200002	超高精度電子ビーム描画装置 100kV	エリオニクス	ELS-7000HM	35,200	2,400	6,800	6,800	11,200	11,200	15,600
AP-200003	マスクアライナ	ミカサ	MA-20	13,200	1,400	2,000	5,800	6,400	10,200	10,800
AP-200004	レーザー描画装置	ネオアーク	DDB-201-200	22,000	900	3,000	5,300	7,400	9,700	11,800
AP-200005	真空蒸着装置	サンバック	ED-1500R	22,000	1,400	2,000	5,800	6,400	10,200	10,800
AP-200006	プラズマCVD装置	サムコ	PD-220ESN	22,000	1,700	4,500	6,100	8,900	10,500	13,300
AP-200007	液体ソースプラズマCVD装置	サムコ	PD-10C1	22,000	600	800	5,000	5,200	9,400	9,600
AP-200008	ヘリコンスパッタリング装置	アルバック	MPS-4000C1/HC1	13,200	3,500	4,700	7,900	9,100	12,300	13,500
AP-200009	イオンビームスパッタ装置	アルバック	IBS-6000S	13,200	1,500	2,000	5,900	6,400	10,300	10,800
AP-200010	原子層堆積装置	ピコサン	SUNALE-R	13,200	2,900	5,100	7,300	9,500	11,700	13,900
AP-200012	反応性イオンエッチング装置	サムコ	RIE-101iPH	13,200	2,200	4,300	6,600	8,700	11,000	13,100
AP-200013	反応性イオンエッチング装置	サムコ	RIE-10NRV	13,200	2,200	4,000	6,600	8,400	11,000	12,800
AP-200014	ドライエッチング装置	アルバック	NLD-500	13,200	1,200	1,800	5,600	6,200	10,000	10,600
AP-200015	イオンミリング装置	アルバック	IBE-6000S	13,200	1,100	1,500	5,500	5,900	9,900	10,300
AP-200017	電界放射型走査型電子顕微鏡	日本電子	JSM-6700FT	22,000	1,100	1,100	5,500	5,500	9,900	9,900
AP-200018	電子ビーム描画装置	エリオニクス	ELS-3700	26,400	1,000	1,800	5,400	6,200	9,800	10,600
AP-200019	電子線描画装置	エリオニクス	ELS-7300	70,400	1,700	5,000	6,100	9,400	10,500	13,800
AP-200020	両面マスクアライナ	ズースマイクロテック	MA-6	17,600	900	2,900	5,300	7,300	9,700	11,700
AP-200021	ECR加工装置	エリオニクス	EIS-200ER	44,000	1,000	1,500	5,400	5,900	9,800	10,300
AP-200022	ICP加工装置	エリオニクス	EIS-700S	26,400	1,000	1,000	5,400	5,400	9,800	9,800
AP-200023	超高真空5源ヘリコンスパッタ	菅製作所	Av028	26,400	1,300	2,400	5,700	6,800	10,100	11,200
AP-200024	ALD製膜装置	Cambride NanoTech	Savannah 100	26,400	1,500	2,700	5,900	7,100	10,300	11,500
AP-200026	スパッタ装置	キャノンアネルバ	SPF-210H	26,400	300	500	4,700	4,900	9,100	9,300
AP-200027	EB加熱・抵抗加熱蒸着装置	アルバック	EBX-8C	35,200	2,100	2,400	6,500	6,800	10,900	11,200
AP-200028	EB加熱・抵抗加熱蒸着装置	菅製作所	AV096-000	17,600	1,700	2,700	6,100	7,100	10,500	11,500
AP-200029	FIB加工装置	エリオニクス	EIP-3300	44,000	1,500	1,900	5,900	6,300	10,300	10,700
AP-200057	ナノカーボン成長炉	ナノデバイス	Easy tube system	44,000	400	400	4,800	4,800	9,200	9,200
AP-200058	エリプソメーター	日本分光	M-500S	6,200	200	700	4,600	5,100	9,000	9,500
AP-200059	超高速スキャン高精度電子ビーム露光装置	エリオニクス	ELS-F130HM	35,200	6,900	26,600	11,300	31,000	15,700	35,400
AP-200060	半導体薄膜堆積装置	パスカル	PAC-LMBE	35,200	2,400	5,800	6,800	10,200	11,200	14,600
AP-200063	電子線三次元粗さ解析装置	エリオニクス	ERA-8000FE	35,200	1,200	1,300	5,600	5,700	10,000	10,100
AP-200066	コンパクトスパッタ装置	アルバック	ACS-4000-C3-HS	13,200	2,900	4,700	7,300	9,100	11,700	13,500
AP-200067	ICP高密度プラズマエッチング装置	サムコ	RIE-101iHS	13,200	1,900	5,700	6,300	10,100	10,700	14,500
AP-200068	スパッタ装置	菅製作所	SSP3000Plus	26,400	700	1,500	5,100	5,900	9,500	10,300
AP-200069	ダイシングソー	DISCO	DAD322	17,600	700	1,000	5,100	5,400	9,500	9,800
AP-200072	多元スパッタ装置	アルバック	QAM-4-ST	26,400	5,500	7,000	9,900	11,400	14,300	15,800
AP-200073	シリコン深堀りエッチング装置	SPPテクノロジーズ	APX-ASE-Pegasus-Polestar	35,200	4,300	9,500	8,700	13,900	13,100	18,300
AP-200074	電子ビーム蒸着装置	エイコーエンジニアリング	EB-580S	26,400	2,100	2,800	6,500	7,200	10,900	11,600
AP-200075	レーザー顕微鏡	キーエンス	VK-9700/9710	26,400	700	1,400	5,100	5,800	9,500	10,200
AP-200076	UV-オゾンクリーナー	サムコ	UV-1	8,800	600	600	5,000	5,000	9,400	9,400
AP-200077	光学干渉式膜厚計	フィルメトリクス	F20-UV	26,400	700	900	5,100	5,300	9,500	9,700
AP-200078	原子層堆積装置(粉末対応型)	ピコサン	R-200 advanced	26,400	4,100	7,400	8,500	11,800	12,900	16,200
AP-200034	ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM)	日本電子	JSM-6500F	35,200	2,200	4,300	6,600	8,700	11,000	13,100
AP-200035	超高真空・極低温・高磁場SPM(LT-UHV-SPM)	日本電子	JAFM4500LT	26,400	1,500	6,900	5,900	11,300	10,300	15,700
AP-200036	超高圧電子顕微鏡群	日本電子	JEM-ARM1300	70,400	3,600	5,000	8,000	9,400	12,400	13,800
AP-200039	電界放射型電子顕微鏡(200kV FEG-TEM)	日本電子	JEM-2010F	70,400	2,400	2,400	6,800	6,800	11,200	11,200
AP-200041	超薄膜評価装置	日立	HD-2000	17,600	2,600	7,000	7,000	11,400	11,400	15,800
AP-200042	集束イオンビーム加工観察装置	日立	FB-2100	22,000	2,300	4,600	6,700	9,000	11,100	13,400
AP-200043	透過電子顕微鏡(TEM)	日本電子	JEM-2010	35,200	2,200	4,300	6,600	8,700	11,000	13,100
AP-200045	フィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザ(FE-EPMA)	日本電子	JXA-8530F	35,200	3,600	8,400	8,000	12,800	12,400	17,200
AP-200046	複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM)	日本電子	JIB-4601F	35,200	3,400	5,600	7,800	10,000	12,200	14,400
AP-200047	複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM)EDS・EBSDオプション	日本電子	EDS-2000X(SDD)/BS-2106(YAG)EBSD(EBSD)	0	400	800	400	800	400	800
AP-200052	オージェ電子分光装置	日本電子	JAMP-9500F	35,200	2,300	7,800	6,700	12,200	11,100	16,600
AP-200053	X線光電子分光装置	日本電子	JPS-9200	35,200	1,800	5,400	6,200	9,800	10,600	14,200
AP-200054	スピンSEM	ハイパーエンジンアリング・北大共同開発		26,400	2,200	2,600	6,600	7,000	11,000	11,400
AP-200055	超高真空STM・スピン偏極STM装置	オミクロン	STM/AFM, VT-STM	26,400	3,000	4,600	7,400	9,000	11,800	13,400
AP-200056	時間分解光電子顕微鏡システム	エルミテック	PEEM-III	140,800	2,600	5,500	7,000	9,900	11,400	14,300
AP-200061	高分解能3次元構造評価装置	日本FEI	Titan3 G2 60-300	70,400	7,400	29,800	11,800	34,200	16,200	38,600
AP-200062	収差補正走査型透過電子顕微鏡	日本電子	JEM-ARM200F	44,000	5,100	15,900	9,500	20,300	13,900	24,700
AP-200064	走査型プローブ顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー	NanoNavi Station SPA300	35,200	200	400	4,600	4,800	9,000	9,200
AP-200065	超高真空AFM	日本電子	JAFM-4500XT	211,200	1,200	1,600	5,600	6,000	10,000	10,400
AP-200070	大気中光電子分光装置	理研計器	AC-3	13,200	2,200	4,200	6,600	8,600	11,000	13,000
AP-200071	超高分解能走査型電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	SU8230	26,400	2,300	4,500	6,700	8,900	11,100	13,300
AP-200079	精密イオンミリングシステム	日本ガタン	PIPSII model 695	35,200	1,300	1,400	5,700	5,800	10,100	10,200
AP-200080	レーザー描画装置	ハイデルベルグ	DWL66+	35,200	5,000	8,500	9,400	12,900	13,800	17,300
AP-200081	集束イオンビーム加工観察装置	日本電子	JEM-9320FIB	0	2,100	4,800	6,500	9,200	10,900	13,600
AP-200082	X線光電子分光装置	日本電子	JPS-9200	30,800	1,600	5,300	6,000	9,700	10,400	14,100
AP-200083	プラズマ式原子層堆積装置	サムコ	AD-230LP-H	35,200	4,400	10,300	8,800	14,700	13,200	19,100
AP-200084	卓上型ランプ加熱装置	アドバンス理工	MILA-5000-P-N	35,200	1,600	1,700	6,000	6,100	10,400	10,500
AP-200085	量子・電子制御ナノマテリアル・顕微物性測定装置	日本電子	JEM-ARM200F NEOARM	35,200	5,200	12,200	9,600	16,600	14,000	21,000
AP-200086	ガラスインプリント装置	東芝機械	GMP-415V	35,200	2,000	4,600	6,400	9,000	10,800	13,400
AP-200087	顕微紫外可視分光装置	日本分光	MSV-5200	8,800	2,100	3,200	6,500	7,600	10,900	12,000
AP-200088	微細形状測定機	小坂研究所	ET200	17,600	600	800	5,000	5,200	9,400	9,600
AP-200089	マニュアルスパッタ	自作	-	17,600	700	1,100	5,100	5,500	9,500	9,900
AP-200090	ラマンイメージング装置	堀場製作所	HR-Evolution type pa nano	26,400	2,900	4,200	7,300	8,600	11,700	13,000

技術支援料（サンプル前処理・設計等）	技術相談料
4,400円 / 時間 （ただし、高度な知識及び経験を必要とされる作業、複数の技術を組み合わせる作業、その他の難易度の高い作業を伴う場合にあっては8,800円）	11,000円 / 時間

【 支援装置料金表＜データ提供**なし**＞ 】2024年4月1日 改定

北海道大学 ナノテクノロジー連携研究推進室

設備番号	装置名	メーカー	型式	初回講習料	利用料(円/1h)		技術補助料(円/1h)		技術代行料(円/1h)	
					学外者(大学・公的機関)	学外者(一般)	学外者(大学・公的機関)	学外者(一般)	学外者(大学・公的機関)	学外者(一般)
AP-200001	超高精度電子ビーム描画装置 125kV	エリオニクス	ELS-F125-U	35,200	4,800	10,700	9,200	15,100	13,600	19,500
AP-200002	超高精度電子ビーム描画装置 100kV	エリオニクス	ELS-7000HM	35,200	3,000	8,800	7,400	13,200	11,800	17,600
AP-200003	マスクアライナ	ミカサ	MA-20	13,200	1,800	2,600	6,200	7,000	10,600	11,400
AP-200004	レーザー描画装置	ネオアーク	DDB-201-200	22,000	1,100	3,800	5,500	8,200	9,900	12,600
AP-200005	真空蒸着装置	サンバック	ED-1500R	22,000	1,800	2,500	6,200	6,900	10,600	11,300
AP-200006	プラズマCVD装置	サムコ	PD-220ESN	22,000	2,200	5,700	6,600	10,100	11,000	14,500
AP-200007	液体ソースプラズマCVD装置	サムコ	PD-10C1	22,000	800	1,000	5,200	5,400	9,600	9,800
AP-200008	ヘリコンスパッタリング装置	アルバック	MPS-4000C1/HC1	13,200	4,400	6,000	8,800	10,400	13,200	14,800
AP-200009	イオンビームスパッタ装置	アルバック	IBS-6000S	13,200	1,900	2,600	6,300	7,000	10,700	11,400
AP-200010	原子層堆積装置	ピコサン	SUNALE-R	13,200	3,700	6,500	8,100	10,900	12,500	15,300
AP-200012	反応性イオンエッチング装置	サムコ	RIE-101iPH	13,200	2,900	5,500	7,300	9,900	11,700	14,300
AP-200013	反応性イオンエッチング装置	サムコ	RIE-10NRV	13,200	2,800	5,200	7,200	9,600	11,600	14,000
AP-200014	ドライエッチング装置	アルバック	NLD-500	13,200	1,500	2,300	5,900	6,700	10,300	11,100
AP-200015	イオンミリング装置	アルバック	IBE-6000S	13,200	1,400	1,900	5,800	6,300	10,200	10,700
AP-200017	電界放射型走査型電子顕微鏡	日本電子	JSM-6700FT	22,000	1,400	1,400	5,800	5,800	10,200	10,200
AP-200018	電子ビーム描画装置	エリオニクス	ELS-3700	26,400	1,300	2,300	5,700	6,700	10,100	11,100
AP-200019	電子線描画装置	エリオニクス	ELS-7300	70,400	2,200	6,400	6,600	10,800	11,000	15,200
AP-200020	両面マスクアライナ	ズースマイクロテック	MA-6	17,600	1,200	3,800	5,600	8,200	10,000	12,600
AP-200021	ECR加工装置	エリオニクス	EIS-200ER	44,000	1,200	1,900	5,600	6,300	10,000	10,700
AP-200022	ICP加工装置	エリオニクス	EIS-700S	26,400	1,300	1,300	5,700	5,700	10,100	10,100
AP-200023	超高真空5源ヘリコンスパッタ	菅製作所	Av028	26,400	1,700	3,100	6,100	7,500	10,500	11,900
AP-200024	ALD製膜装置	Cambride NanoTech	Savannah 100	26,400	1,900	3,500	6,300	7,900	10,700	12,300
AP-200026	スパッタ装置	キャノンアネルバ	SPF-210H	26,400	400	600	4,800	5,000	9,200	9,400
AP-200027	EB加熱・抵抗加熱蒸着装置	アルバック	EBX-8C	35,200	2,600	3,100	7,000	7,500	11,400	11,900
AP-200028	EB加熱・抵抗加熱蒸着装置	菅製作所	AV096-000	17,600	2,100	3,500	6,500	7,900	10,900	12,300
AP-200029	FIB加工装置	エリオニクス	EIP-3300	44,000	1,900	2,500	6,300	6,900	10,700	11,300
AP-200057	ナノカーボン成長炉	ナノデバイス	Easy tube system	44,000	500	500	4,900	4,900	9,300	9,300
AP-200058	エリプソメーター	日本分光	M-500S	6,200	200	900	4,600	5,300	9,000	9,700
AP-200059	超高速スキャン高精度電子ビーム露光装置	エリオニクス	ELS-F130HM	35,200	8,800	34,200	13,200	38,600	17,600	43,000
AP-200060	半導体薄膜堆積装置	パスカル	PAC-LMBE	35,200	3,100	7,400	7,500	11,800	11,900	16,200
AP-200063	電子線三次元粗さ解析装置	エリオニクス	ERA-8000FE	35,200	1,500	1,600	5,900	6,000	10,300	10,400
AP-200066	コンパクトスパッタ装置	アルバック	ACS-4000-C3-HS	13,200	3,800	6,100	8,200	10,500	12,600	14,900
AP-200067	ICP高密度プラズマエッチング装置	サムコ	RIE-101iHS	13,200	2,400	7,300	6,800	11,700	11,200	16,100
AP-200068	スパッタ装置	菅製作所	SSP3000Plus	26,400	800	2,000	5,200	6,400	9,600	10,800
AP-200069	ダイシングソー	DISCO	DAD322	17,600	800	1,300	5,200	5,700	9,600	10,100
AP-200072	多元スパッタ装置	アルバック	QAM-4-ST	26,400	7,100	9,000	11,500	13,400	15,900	17,800
AP-200073	シリコン深堀りエッチング装置	SPPテクノロジーズ	APX-ASE-Pegasus-Polestar	35,200	5,500	12,200	9,900	16,600	14,300	21,000
AP-200074	電子ビーム蒸着装置	エイコーエンジニアリング	EB-580S	26,400	2,600	3,600	7,000	8,000	11,400	12,400
AP-200075	レーザー顕微鏡	キーエンス	VK-9700/9710	26,400	900	1,800	5,300	6,200	9,700	10,600
AP-200076	UV-オゾンクリーナー	サムコ	UV-1	8,800	800	800	5,200	5,200	9,600	9,600
AP-200077	光学干渉式膜厚計	フィルメトリクス	F20-UV	26,400	800	1,100	5,200	5,500	9,600	9,900
AP-200078	原子層堆積装置(粉末対応型)	ピコサン	R-200 advanced	26,400	5,200	9,500	9,600	13,900	14,000	18,300
AP-200034	ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM)	日本電子	JSM-6500F	35,200	2,900	5,500	7,300	9,900	11,700	14,300
AP-200035	超高真空・極低温・高磁場SPM(LT-UHV-SPM)	日本電子	JAFM4500LT	26,400	1,900	8,800	6,300	13,200	10,700	17,600
AP-200036	超高圧電子顕微鏡群	日本電子	JEM-ARM1300	70,400	4,600	6,400	9,000	10,800	13,400	15,200
AP-200039	電界放射型電子顕微鏡(200kV FEG-TEM)	日本電子	JEM-2010F	70,400	3,100	3,100	7,500	7,500	11,900	11,900
AP-200041	超薄膜評価装置	日立	HD-2000	17,600	3,300	9,000	7,700	13,400	12,100	17,800
AP-200042	集束イオンビーム加工観察装置	日立	FB-2100	22,000	2,900	6,000	7,300	10,400	11,700	14,800
AP-200043	透過電子顕微鏡(TEM)	日本電子	JEM-2010	35,200	2,800	5,600	7,200	10,000	11,600	14,400
AP-200045	フィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザ(FE-EPMA)	日本電子	JXA-8530F	35,200	4,600	10,800	9,000	15,200	13,400	19,600
AP-200046	複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM)	日本電子	JIB-4601F	35,200	4,300	7,100	8,700	11,500	13,100	15,900
AP-200047	複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM)(EDS・EBSDオプション	日本電子	(ID-2106026)(B-2106517)(SSD102)(EBSD)	0	500	1,000	500	1,000	500	1,000
AP-200052	オージェ電子分光装置	日本電子	JAMP-9500F	35,200	3,000	10,000	7,400	14,400	11,800	18,800
AP-200053	X線光電子分光装置	日本電子	JPS-9200	35,200	2,300	6,900	6,700	11,300	11,100	15,700
AP-200054	スピンSEM	ライトーエンジニアリング・北大共同開発		26,400	2,800	3,300	7,200	7,700	11,600	12,100
AP-200055	超高真空STM・スピン偏極STM装置	オミクロン	STM/AFM, VT-STM	26,400	3,900	5,900	8,300	10,300	12,700	14,700
AP-200056	時間分解光電子顕微鏡システム	エルミテック	PEEM-III	140,800	3,400	7,100	7,800	11,500	12,200	15,900
AP-200061	高分解能3次元構造評価装置	日本FEI	Titan3 G2 60-300	70,400	9,500	38,300	13,900	42,700	18,300	47,100
AP-200062	収差補正走査型透過電子顕微鏡	日本電子	JEM-ARM200F	44,000	6,500	20,500	10,900	24,900	15,300	29,300
AP-200064	走査型プローブ顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー	NanoNavi Station SPA300	35,200	200	400	4,600	4,800	9,000	9,200
AP-200065	超高真空AFM	日本電子	JAFM-4500XT	211,200	1,500	2,000	5,900	6,400	10,300	10,800
AP-200070	大気中光電子分光装置	理研計器	AC-3	13,200	2,900	5,400	7,300	9,800	11,700	14,200
AP-200071	超高分解能走査型電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	SU8230	26,400	2,900	5,800	7,300	10,200	11,700	14,600
AP-200079	精密イオンミリングシステム	日本ガタン	PIPSII model 695	35,200	1,700	1,800	6,100	6,200	10,500	10,600
AP-200080	レーザー描画装置	ハイデルベルグ	DWL66+	35,200	6,400	10,900	10,800	15,300	15,200	19,700
AP-200081	集束イオンビーム加工観察装置	日本電子	JEM-9320FIB	0	2,700	6,200	7,100	10,600	11,500	15,000
AP-200082	X線光電子分光装置	日本電子	JPS-9200	30,800	2,100	6,800	6,500	11,200	10,900	15,600
AP-200083	プラズマ式原子層堆積装置	サムコ	AD-230LP-H	35,200	5,700	13,200	10,100	17,600	14,500	22,000
AP-200084	卓上型ランプ加熱装置	アドバンス理工	MILA-5000-P-N	35,200	2,100	2,100	6,500	6,500	10,900	10,900
AP-200085	量子・電子制御ナノマテリアル・顕微物性測定装置	日本電子	JEM-ARM200F NEOARM	35,200	6,700	15,600	11,100	20,000	15,500	24,400
AP-200086	ガラスインプリント装置	東芝機械	GMP-415V	35,200	2,600	5,900	7,000	10,300	11,400	14,700
AP-200087	顕微紫外可視分光装置	日本分光	MSV-5200	8,800	2,700	4,100	7,100	8,500	11,500	12,900
AP-200088	微細形状測定機	小坂研究所	ET200	17,600	800	1,100	5,200	5,500	9,600	9,900
AP-200089	マニュアルスパッタ	自作	-	17,600	900	1,400	5,300	5,800	9,700	10,200
AP-200090	ラマンイメージング装置	堀場製作所	HR-Evolution type pa nano	26,400	3,700	5,400	8,100	9,800	12,500	14,200

技術支援料（サンプル前処理・設計等）	技術相談料
4,400円 / 時間 （ただし、高度な知識及び経験を必要とされる作業、複数の技術を組み合わせる作業、その他の難易度の高い作業を伴う場合にあっては8,800円）	11,000円 / 時間